# Rietveld および MEM 解析による(Bi,La)<sub>4</sub>(Ti,Si,Mo)<sub>3</sub>O<sub>12</sub> 強誘電体の結晶構造解析

Rietveld and MEM Analyses on Crystal Structures of (Bi,La)<sub>4</sub>(Ti,Si,Mo)<sub>3</sub>O<sub>12</sub> Ferroelectric Materials

井手本 康<sup>1)</sup>、北村 尚斗<sup>1)</sup>、浜尾 尚樹<sup>1)</sup>、室井 諒<sup>1)</sup>、熊谷 雄輔<sup>1)</sup>、井川 直樹<sup>2)</sup> Yasushi IDEMOTO Naoto KITAMURA Naoki HAMAO Ryo MUROI Yusuke KUMAGAI Naoki IGAWA

<sup>1)</sup>東京理科大学理工学部 <sup>2)</sup>日本原子力研究開発機構

#### (概要)

本研究では不揮発性メモリーデバイスとしての応用が期待されている(Bi,La)4(Ti,Mo,Si)3O12 系強誘電体に着目し、Rietveld法による結晶構造解析を行うことで、強誘電特性と結晶構造の相関関係を検討した。これらの物質の中性子回折測定を行い、得られた結果をもとに結晶構造を精密化した結果、層状ペロブスカイト型構造(S.G.: B11n)の単一相であり、酸化ビスマス層の酸素が欠損しやすいことが明らかとなった。また、その原子位置からTi-O6 八面体の歪みを検討した結果、ペロブスカイト層の中心に位置する八面体の歪みが特に大きく、自発分極への寄与も大きいことが明らかとなった。

#### キーワード:

強誘電体、 層状ペロブスカイト型酸化物、結晶構造、Rietveld・MEM 解析

#### <u>1. 目的</u>

近年、大容量、高速、低消費電力、不揮発性を同時に実現する強誘電体メモリー(FeRAM)がマルチメディア 機器用の次世代型メモリーデバイスとして注目されており、精力的に研究されている。現在、優れた強誘電特性を 示す物質の主流は Pb(Zr, Ti)O<sub>3</sub> 系酸化物であるが、環境負荷の大きい鉛を多量に含んでいるため、代替物質と して非鉛強誘電体の開発が急務となっている。このような背景から、比較的高い残留分極と低い抗電界を示す層 状ペロブスカイト型構造をもつ一連の Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> 系強誘電体が期待されている[1]。Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub>は Bi を La で部分 置換することで強誘電特性が大幅に改善されることが報告されており、当研究室でも(Bi,La)<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> に注目し、Ti サイトへの Mo 置換や Bi<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>添加[2]により残留分極が増加することを明らかにしてきた。しかし、これらの置換・ 添加が結晶構造に与える影響については不明な点が多く、強誘電特性との相関関係は明らかになっていない。ま た、同物質は極めて複雑な結晶構造をもつ酸化物であることから、高分解能な中性子回折実験の遂行が必要とさ れている。そこで本研究では、Mo 置換および Bi<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>添加を行った(Bi,La)<sub>4</sub>(Ti,Si,Mo)<sub>3</sub>O<sub>12</sub>について、高分解 能粉末中性子回折装置(HRPD)により回折パターンを測定し、Rietveld・MEM 解析を行うことで、その結晶構造 を詳細に検討することを目的とした。

### <u>2. 方法</u>

(Bi,La)4(Ti,Si,Mo)<sub>3</sub>O<sub>12</sub> は各単純酸化物あるいは炭酸塩を出発物質とした固相法により合成した。なお、Si 源 に関しては Bi<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>を用いた。得られた試料について、粉末 X 線回折測定により相の同定を行い、ICP 発光分光分析により金属成分の組成を決定した。強誘電特性の評価は、強誘電テスターによる *PE*ヒステリシスループ測定および LCR メータを用いた誘電率測定により行った。結晶構造を詳細に検討するため、これらの試料(約1g)をバナジウム管に充填し、HRPD により回折パターン( $\lambda$ =1.8237 Å, 2 $\theta$ =2.5~162.4 °, Step=0.05 °)を測定した。なお、これらの測定は室温・常圧下で行った。得られた結果を用いて、Rietveld・MEM 解析 (Rietan-FP, PRIMA)により結晶構造を精密化した。また、解析により得られた格子定数と各原子の座標から Ti-O<sub>6</sub> 八面体歪みと自発分極を理論的に算出し、*PE*ヒステリシスループから得られた残留分極と比較することで、結晶構造と強誘電特性の相関関係を検討した。

### 3. 研究成果

合成した(Bi,La)<sub>4</sub>(Ti,Si,Mo)<sub>3</sub>O<sub>12</sub>について粉末 X 線回折測定を行った結果、いずれも Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub>と同じ層状ペロブスカイト型構造であることがわかった。また、Mo 置換あるいは Bi<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>添加により(001)面のピーク強度が増加し、ab 面内方向に粒成長することが示唆された。さらに、ICPより各金属成分の組成は十分に制御できているこ

とがわかった。各試料の PEヒステリシスループ を測定した結果、Mo 置換および Bi4Si3O12 添 加により残留分極が顕著に増加、抗電界は若 干低下し、強誘電特性が改善されることが明ら かとなった。

このように強誘電特性が変化した要因の1つ として置換・添加による結晶構造の変化が考え られる。そこで、粉末中性子回折パターンを測 定し、Rietveld 解析を行った。一例として、Fig. 1 に Bi3.25La0.75Ti3O12 のフィッテングパターン を、Table 1 に結晶構造パラメータを示す。強 誘電相として報告されている単斜晶(S.G.: B11n)の単一相を仮定することで、実測の回折 パターンと計算値が良い一致を示した。また、 各サイトの占有率から酸化ビスマス層の酸素 (04)が欠損しやすいことが示唆された。精密化 した原子位置より Ti-O6 八面体の歪みパラメー タ[3]を求めた。その結果、結合角に関する歪 み ゆ はペロブスカイト層の中心に位置する Ti-O<sub>6</sub> 八面体では 101.62 deg.<sup>2</sup>、両端では 77.43, 85.16 deg.2 であり、ペロブスカイト層の 中心において歪みが大きいことが明らかとなっ た。また、常誘電相における理想原子位置から の変位より算出した自発分極は a 軸方向に 19.96 µC/cm<sup>2</sup>、c軸方向に2.46 µC/cm<sup>2</sup>であ り、酸化ビスマス層に比べてペロブスカイト層の 自発分極への寄与が大きいことがわかった。な お、この自発分極の値は PE ヒステリシス測定 により得られた残留分極に比べて大きな値であ るが、このような相違の原因として、酸素空孔に よるドメインピニング等の影響が考えられる。

## <u>4. 結論·考察</u>

層状ペロブスカイト型(Bi,La)4(Ti,Si,Mo)3O12 に ついて中性子回折パターンを測定し、Rietveld・ MEM 解析を行った。その結果、酸化ビスマス層 に酸素空孔が生成しやすく、ペロブスカイト層の中 心において歪みが大きいことが明らかとなった。ま た、ペロブスカイト層は自発分極に大きく寄与して いることが明らかとなった。Mo 置換・Bi4Si3O12 添 加はペロブスカイト層のBサイトに直接影響するた め、このことが残留分極が大きく増加した一因であ ると考えられる。

### 5. 引用(参照)文献等

B.H. Park, B.S. Kang, S.D. Bu, T.W. Noh,
J. Lee, W. Jo, *Nature*, **401**, 682 (1999).

[2] Y. Idemoto, T. Miyahara, N. Koura, T. Kijima, H. Ishiwara, *Solid State Commun.*, **128**, 255 (2003).

[3] K. Robinson, G.V. Gibbs, P.H. Ribbe, *Science*, **172**, 567 (1970).



Fig. 1 Rietveld refinement pattern of  $Bi_{3.25}La_{0.75}Ti_{3}O_{12}$ . (S. G.; B11n,  $R_{wp} = 6.48$  %,  $R_{p} = 5.01$  %,  $R_{e}=5.54$  %)

Table 1 Refined structure parameters of Bi<sub>3.25</sub>La<sub>0.75</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub>. Lattice parameter: a=0.54242(9)nm, b=0.54130(9)nm, c=3.2881(5)nm,  $\gamma=89.99(1)^{\circ}$ 

Atom	Site	X	У	Ζ	$10^2 \times B$ (nm <sup>2</sup> )	Site occupancy
Bi1	4b	0.174(7)	0.540(8)	0.5640(4)	2.2(4)	0.625
Bi2	4b	0.179(5)	0.535(8)	0.4314(4)	0.4(3)	0.625
Bi3	4b	0.187(7)	0.525(9)	0.7120(4)	1.1(3)	1
Bi4	4b	0.187(8)	0.553(9)	0.2892(4)	1.8(4)	1
La1	4b	= <i>x</i> (Bi1)	$=_{y}(Bi1)$	= <i>z</i> (Bi1)	= <i>B</i> (Bi1)	0.375
La2	4b	= <i>x</i> (Bi2)	= <i>y</i> (Bi2)	= <i>z</i> (Bi2)	= <i>B</i> (Bi2)	0.375
Ti1	4b	0.161	0.026	0.4966	0.2(3)	1
Ti2	4b	0.143(9)	0.045(12)	0.6301(7)	0.1	1
Ti3	4b	0.151(10)	0.031(11)	0.3725(7)	0.1	1
01	4b	0.354(7)	0.321(9)	0.5040(7)	1.4(5)	0.95(2)
02	4b	0.411(10)	-0.187(10)	0.4928(7)	2.3(6)	1
03	4b	0.420(7)	0.295(9)	0.2523(4)	0.08	1
04	4b	0.428(8)	0.781(9)	0.7534(5)	0.02	0.91(2)
O5	4b	0.137(7)	-0.017(9)	0.5598(6)	0.2(4)	1
06	4b	0.117(8)	0.095(11)	0.4416(7)	1.4(5)	1
07	4b	0.157(9)	0.095(9)	0.6810(8)	1.8(6)	1
08	4b	0.152(8)	0.000(9)	0.3180(7)	1.3(5)	0.98(3)
09	4b	0.413(7)	0.276(10)	0.6133(8)	0.1	1
O10	4b	0.412(8)	-0.186(10)	0.3877(8)	1.0(5)	0.99(3)
011	4b	0.378(8)	-0.241(10)	0.6208(7)	1.8(5)	1
012	4b	0.344(7)	0.337(9)	0.3740(5)	0.1	1